

007918837

WPI Acc No: 1989-183949/198925

Lamination of printed substrate - producing difference between vacuum pressure in vacuum tank and that of absorbing mechanism

Patent Assignee: HITACHI CONDENSER KK (HITL); HITACHI LTD (HITA

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date JP 1123723 Α 19890516 JP 87280928 Α 19871109 198925 B

Priority Applications (No Type Date): JP 87280928 A 19871109

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pq Main IPC Filing Notes

JP 1123723

Abstract (Basic): JP 1123723 A

In a device to laminate a sensitised resin film to a printed substrate in a vacuum tank, an adsorbing mechanism to hold the film is formed with a guide to guide the film to a given position and adsorbing holes formed in the guide.

In lamination of a printed substrate, a difference between a vacuum pressure in a vacuum tank and that of the adsorbing mechanism is produced. By producing the differential pressure, the film can be held in the vacuum tank even under a pressure reduced state.

USE/ADVANTAGE - Reduces prodn. of poor laminate during the starting of lamination and cutting of a film since the film can be adsorbed for holding during a work to laminate a dry film in a vacuum tank.

0/3

⑫ 公開特許公報(A) 平1-123723

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成1年(1989)5月16日

B 29 C 63/02 H 05 K 3/06 // B 29 L 9:00 7729-4F J-6679-5F

4F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

劉発明の名称 プリント基板のラミネート方法

②特 願 昭62-280928

→ 愛出 願 昭62(1987)11月9日

70発 明 者 福 岡 洋 一

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川

工場内

⑩発 明 者 佐 々 木 秀 昭

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川

工場内

@発明者和波 正博

神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川

工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会 東京都品川区西五反田1-31-1

願 人 日立コンデンサ株式会

社

邳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

の出

m 如 本

1. 発明の名称

プリント基板のラミネート方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 真空槽内でプリント基板に感光性樹脂フィルムをラミネートする装置において、前記フィルムを所定の位置へ案内するガイドと、前記ガイドに吸着孔を設け、フィルムを保持する吸着機構を構成し、真空槽内の真空圧と吸着機構の真空圧に差を設け、減圧下状態においても、その差圧を設けることにより、真空槽内での前述のフィルムの吸着保持を可能としたことを特徴とするプリント基板のラミネート方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プリント基板に感光性樹脂フィルムをラミネートする装置に係り、特に真空槽内でラミネートし、かつラミネート后のフィルムを切断する機能を有する装置に好適な感光性樹脂フィルムの保持方法と装置に関する。

(従来の技術)

従来の装置は、特開昭58-121696号に記載の様に、ラミネート前及びラミネート後のフィルムの切断后のガイド及びフィルムの保持に関しては何ら考慮されていなかった。

(発明が解決しようとする問題点)

上記従来技術は、フィルム貼付時のフィルム先端のおどり及び切断後のフィルムのすべり落ちに対しては配慮がされておらず、シワ,気泡等のラミネート品質に影響を及ぼすラミネート不良発生の問題があった。

本発明の目的は、真空槽内におけるラミネート 作業に関し、シワ、気泡等のラミネート不良の発 生要因を排除することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、真空槽内においても、フィルム貼付のおどり、フィルム切断時のすべり落ちを防止 すべく、フィルムを保持する手段を用いることに より違成される。

保持する手段として、本発明では、真空槽内の

真空圧よりさらに低い真空圧を発生させ、 その差 圧によりフィルムの吸着保持を可能とした。

(作用)

真空 内の真空圧より低い真空圧の発生を可能とする真空機器の末端をフィルムを所定位置へ案内するガイドの先端に設けることにより、その差圧により、真空内であってもガイド上のフィルムは、貼付時及びフィルム切断時共に、そのわずかな差圧により吸着保持される。それにより、貼付時のフィルム先端のおどり、切断時のフィルムのすべり落ちは防止出来るので、ラミネート時のラミネート不良の発生がない。

(実施例)

以下、本発明の一実施例について図面を用いて設明する。

第1図は、本実施例の主要構成を示す。

真空槽7と大気遮断ロール8とにより、所定の 真空圧に保たれた真空槽内で、プリント基板1の 表面に感光性樹脂フィルム2をラミネートするに、 先ずフィルム原反10からフィルム送りロール9

吸着孔 5 により、檜内の真空圧 - P a 例えば - 7 4 0 m H 8 より低い真空圧 - P b 例えば - 7 6 0 m H 8 でフィルム 2 を吸引することにより、そこに差圧が発生する。この差圧により吸着保持することで安定した貼付状態が得られる。

本実施例によれば、真空槽内での吸着保持が可能となる。

(発明の効果)

本発明によれば、真空槽内におけるドライフィルムのラミネート作業において、先のフィルムが 吸着保持出来るので、貼付開始時及びフィルム切 断時のラミネート不良の発生が悪い効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例の装置の主要構成を示す断面図、第2回は第1回のラミネート部分を拡大したラミネート開始時を示す部分断面図、第3回はラミネート終了時のフィルム切断時を示す部分断面図である。

1 ··· プリント基板, 2 ··· 感光性樹脂フィルム, 3 ··· ラミネートロール, 4 ··· ガイド, 5 ··· 吸着孔,

によって感光性樹脂フィルム2をラミネートロール3に向けて、所定の長さ送り出す。この時フィルム2は、所定の位置へ案内するためのガイド4の表面上をすべり、セットされる。またラミネートロール3は、基板1とフィルム2が供給されるい機に開放状態となっている。

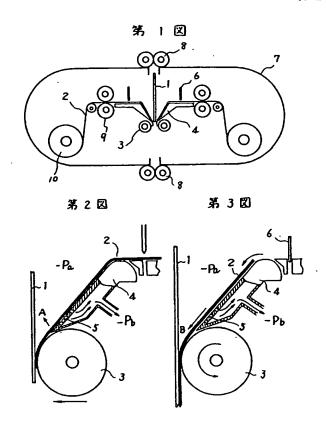
ラミネート開始時は、第2回に示す如く供給らせ、第2回に示す面をするは、第2回に示す面をするは、第2回に示す面をするは、ないないないないないないないないないないないない。そのにおどりは大きなものとなる。また第3回においないないない。カッター6がフィルム2の切断を行るかったののでは、カッター6がフィルム2の切断を行ったいにのテンションにより、フィルム2はB方向へする。

これらの現象を抑えるべく、ガイド4に設けた

6 …カッター, 7 …真空槽。

代理人弁理士 小 川 勝 男

特開平1-123723(3)



第1頁の続き ⑫発 明 者 鈴 木 敏 夫 東京都品川区西五反田 1 - 31 - 1 日立コンデンサ株式会 社内 ⑫発 明 者 小 河 原 章 雄 東京都品川区西五反田 1 - 31 - 1 日立コンデンサ株式会 社内